

2022年度ナノプロセシング施設(NPF)単価表

2022年8月1日改訂

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	技術代行カテゴリ	備考(注1)	成果公開			成果非公開(注3)		
						機器利用	技術補助	技術代行(注2)	機器利用	技術補助	技術代行(注2)
						(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF001	電子ビーム描画装置(CRESTEC)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	2	有償トレーニング	5,000	12,000	13,600	21,000	38,500	42,500
NPF003	イオンコーター(FIB付帯)(2F)	2F 一般実験室	表面処理装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800 FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察装置	3	有償トレーニング	6,000	13,000	15,600	20,000	37,500	44,000
NPF005	低真空走査電子顕微鏡	2F 一般実験室	観察装置	3	有償トレーニング	4,000	11,000	13,600	13,000	30,500	37,000
NPF006	マスク露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	2	有償トレーニング	8,000	15,000	16,600	36,000	53,500	57,500
NPF008	スピコーター(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF009	コンタクトマスクライナー[MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF010	反転露光用全面UV照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF011	i線露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィ装置	3	技術代行専用	15,000	22,000	24,600	65,000	82,500	89,000
NPF012	ドラフトチャンバー(右)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF013	ドラフトチャンバー(左)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF014	有機ドラフトチャンバー_1	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー_1	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置	3		500	7,500	10,100	7,700	25,200	31,700
NPF016	スターラーウォーターバス[SWB-10L-1]	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF017	スマートウォーターバス[TB-1N](フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF018	反応性イオンエッチング装置(RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	13,000	30,500	34,500
NPF019	多目的エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング装置	2	有償トレーニング	8,000	15,000	16,600	36,000	53,500	57,500
NPF021	プラズママッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF022	UVオゾンクリーナー	CR5 クリーンルーム	表面処理装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜装置	2	有償トレーニング	6,000	13,000	14,600	22,000	39,500	43,500
NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	11,000	28,500	32,500
NPF025	スパッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜装置	3	有償トレーニング	2,000	9,000	11,600	10,000	27,500	34,000
NPF030	プラズマCVD薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	2	有償トレーニング	3,500	10,500	12,100	20,000	37,500	41,500
NPF031	原子層堆積装置_1[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜装置	2	技術代行専用	6,000	13,000	14,600	24,000	41,500	45,500
NPF032	クロスセクションポリリッシャー(ALD付帯)	CR1 クリーンルーム	ミリング装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF033	アルゴミリング装置	CR1 クリーンルーム	ミリング装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置(FIB)	2F 一般実験室	イオンビーム装置	3	技術代行専用	10,000	17,000	19,600	36,000	53,500	60,000
NPF035	イオンコーター(SEM付帯)(2F)	2F 一般実験室	表面処理装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF038	二次イオン質量分析装置(D-SIMS)	2F 一般実験室	イオンビーム装置	2	技術代行専用	7,000	14,000	15,600	31,000	48,500	52,500
NPF039	オゾンクリーナー(SIMS付属)	2F 一般実験室	表面処理装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF041	ウェハー酸化炉	CR1 クリーンルーム	熱処理装置	1	有償トレーニング	1,500	8,500	9,000	8,000	25,500	26,700
NPF042	クリーンオープン	CR1 クリーンルーム	熱処理装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF044	マップ炉	CR1 クリーンルーム	熱処理装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	プローブ装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF046	走査プローブ顕微鏡SPM_1[NanoscopeIV/Dimension3100]	CR1 クリーンルーム	プローブ装置	3	有償トレーニング	3,000	10,000	12,600	13,000	30,500	37,000
NPF047	走査プローブ顕微鏡SPM_2[SPM-9600/9700]	2F 一般実験室	プローブ装置	3	有償トレーニング	3,000	10,000	12,600	13,000	30,500	37,000
NPF048	ナノサータ顕微鏡SPM_3[SFT-3500]	CR1 クリーンルーム	プローブ装置	3	有償トレーニング	4,000	11,000	13,600	16,000	33,500	40,000
NPF049	ナノプローバ[N-6000SS]	2F 一般実験室	プローブ装置	3	技術代行専用	8,000	15,000	17,600	28,000	45,500	52,000
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	測定装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	測定装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	測定装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	7,000	24,500	28,500
NPF053	ワイヤーボンダー(2F)	2F 一般実験室	加工装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	加工装置	3	有償トレーニング	3,500	10,500	13,100	16,000	33,500	40,000
NPF055	スクライパー	CR4 クリーンルーム	加工装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF056	研磨機	CR1 クリーンルーム	加工装置	2	有償トレーニング	1,000	8,000	9,600	5,000	22,500	26,500
NPF057	ラッピングマシン(GMP)	CR4 クリーンルーム	加工装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	10,000	27,500	31,500

2022年度ナノプロセス施設(NPF)単価表

2022年8月1日改訂

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	技術代行カテゴリ	備考(注1)	成果公開			成果非公開(注3)		
						機器利用	技術補助	技術代行(注2)	機器利用	技術補助	技術代行(注2)
						(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察装置	1	有償トレーニング	2,000	9,000	9,500	9,000	26,500	27,700
NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察装置	1	有償トレーニング	2,000	9,000	9,500	11,000	28,500	29,700
NPF063	分光エリブソメータ	CR1 クリーンルーム	分光装置	1	有償トレーニング	2,000	9,000	9,500	10,000	27,500	28,700
NPF064	解析用PC(分光エリブソメータ用)	2F データ解析室	分光装置	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF065	顕微レーザーラマン分光装置(RAMAN)	CR1 クリーンルーム	分光装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)	CR1 クリーンルーム	分光装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF067	解析用PC(CADおよびSPM, FT-IR, Raman用)	2F データ解析室	分光装置	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF068	磁気特性測定システム(MPMS)	2F 一般実験室	測定装置	2	有償トレーニング	2,500	9,500	11,100	9,000	26,500	30,500
NPF070	X線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	エックス線装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	13,000	30,500	34,500
NPF071	薄膜エックス線回折装置	2F 一般実験室	エックス線装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	13,000	30,500	34,500
NPF072	微小部蛍光X線分析装置	CR1 クリーンルーム	エックス線装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF073	解析用PC(CADおよびX線用)	2F データ解析室	エックス線装置	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF074	エックス線光電子分光分析装置(XPS)	2F 一般実験室	エックス線装置	2	有償トレーニング	4,000	11,000	12,600	12,000	29,500	33,500
NPF075	解析用PC(XPS用)	2F データ解析室	エックス線装置	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF076	解析用PC(一般解析用)1	2F データ解析室	その他	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF077	解析用PC(一般解析用)2	2F データ解析室	その他	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF078	解析用PC(一般解析用)3	2F データ解析室	その他	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF079	解析用PC(一般解析用)4	2F データ解析室	その他	3		500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF080	ヘリウムイオン顕微鏡	SCR産学官連携研究棟	観察装置	3	技術代行専用	-	-	16,000	-	-	(注4)
NPF081	プラズマCVD薄膜堆積装置(SiN)	CR5 クリーンルーム	成膜装置	2	有償トレーニング	4,000	11,000	12,600	20,000	37,500	41,500
NPF082	化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング装置	2	技術代行専用	9,000	16,000	17,600	36,000	53,500	57,500
NPF084	デジタルマイクロスコブ	CR1 クリーンルーム	観察装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF085	物理特性測定装置(PPMS)	2F 一般実験室	測定装置	2	有償トレーニング	5,000	12,000	13,600	20,000	37,500	41,500
NPF086	マルチアールエハープローバー(2F)	2F 一般実験室	測定装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	8,000	25,500	29,500
NPF088	電界放出形走査電子顕微鏡[S4500/FE-SEM] (2F)	2F 一般実験室	観察装置	3	有償トレーニング	3,000	10,000	12,600	16,000	33,500	40,000
NPF089	赤外線ランプ加熱炉(RTA)	CR1 クリーンルーム	熱処理装置	2	有償トレーニング	2,500	9,500	11,100	11,000	28,500	32,500
NPF091	自動塗布現像装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	2	有償トレーニング	2,000	9,000	10,600	10,000	27,500	31,500
NPF092	高圧ジェットリフトオフ装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	2	有償トレーニング	6,000	13,000	14,600	22,000	39,500	43,500
NPF093	高速電子ビーム描画装置(エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ装置	2	有償トレーニング	25,000	32,000	33,600	62,000	79,500	83,500
NPF094	解析用PC(CAD及び近接効果補正用)	2F データ解析室	その他	3	有償トレーニング	2,000	9,000	11,600	6,000	23,500	30,000
NPF095	RF-DCスパッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF096	単波長エリブソメータ	CR1 クリーンルーム	測定装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF098	ECRスパッタ成膜・ミリング装置	CR1 クリーンルーム	成膜装置	2	有償トレーニング	3,000	10,000	11,600	12,000	29,500	33,500
NPF099	サムコ原子層堆積装置 2[AD-100LP]	CR5 クリーンルーム	成膜装置	2	技術代行専用	4,000	11,000	12,600	18,000	35,500	39,500
NPF100	解析用PC(L-Edit レイアウト・エディタ)	2F データ解析室	その他	3	有償トレーニング	500	7,500	10,100	5,000	22,500	29,000
NPF101	Si深堀エッチング装置[PlasmaPro.100]	CR5 クリーンルーム	エッチング装置	2	有償トレーニング	8,000	15,000	16,600	36,000	53,500	57,500
NPF102	原子層堆積装置 3[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜装置	2	技術代行専用	6,000	13,000	14,600	24,000	41,500	45,500
NPF103	原子層堆積装置 3付帯XPS装置(アルパック・ファイ)	CR5 クリーンルーム	エックス線装置	2	有償トレーニング	4,000	11,000	12,600	12,000	29,500	33,500
NPF104	原子層堆積装置 4[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜装置	2	技術代行専用	6,000	13,000	14,600	24,000	41,500	45,500
NPF105	ピュアオゾン供給装置	CR5 クリーンルーム	その他	1	技術代行専用	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000
NPF106	小型自動現像装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	2	有償トレーニング	1,000	8,000	9,600	5,000	22,500	26,500
NPF107	3次元電界放出形走査電子顕微鏡(エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	観察装置	3	有償トレーニング	8,000	15,000	17,600	20,000	37,500	44,000
NPF108	イオンコーター(エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	表面処理装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF109	6インチ電子ビーム真空蒸着装置(アールデック)	CR1 クリーンルーム	成膜装置	2	有償トレーニング	6,000	13,000	14,600	22,000	39,500	43,500
NPF110	レーザー描画装置[DWL66+]	CR2 イエロールーム	リソグラフィ装置	2	有償トレーニング	10,000	17,000	18,600	45,000	62,500	66,500
NPF111	酸アルカリドラフトチャンバー_2	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置	3		500	7,500	10,100	7,700	25,200	31,700
NPF112	有機ドラフトチャンバー_2	CR1 クリーンルーム	ウェット処理装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
NPF113	スピコーター(EB)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ装置	1		500	7,500	8,000	5,000	22,500	23,700
	有償トレーニング		その他					1,000 (1回)			1,000 (1回)

(注1)「有償トレーニング」と記載された装置につきましては、最初のご利用の前に有償のトレーニングを受講して頂いております。
「技術代行専用」と記載された装置につきましては、原則技術代行のみでのご利用となります。

(注2)NPFのスタッフが他の施設(産総研の他の共用施設及びNIMS、筑波大学等他機関の共用施設)の装置の技術代行を行う場合は、装置の機器利用料に加え一律9,600円(成果公開)、24,000円(成果非公開)を加算致します。

(注3)成果非公開でご利用の場合は、ここに記載された金額の他に15%の「運営管理費」が加算されます。ご了承ください。

(注4)ヘリウムイオン顕微鏡を非公開でご利用になりたい方はスーパークリーンルーム施設よりお申し込みください。
また、本装置はアカデミック割引、中小企業割引の対象外です。

※装置番号:NPFで装置管理のために使用している番号

※消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てて処理致します。

※この単価表に記載した金額に消費税等は含まれておりません。

※ユーザーのご所属により、課金額に下記の係数が掛かります。

その他、支援形態や成果公開の可否によって課金額が変わることがございます。詳しくはNPF事務局(tia-npf-ml@aist.go.jp)にお問い合わせください。

中小企業(中小企業支援法第2条参照) 0.5 (中小企業割引)

大学及び公的研究機関 0.5 (アカデミック割引、産総研所属の利用者はここに該当します。)

上記に該当しない場合は 1

※その他に、来所して装置をご利用いただく場合は、ユーザーのご所属により、連携研究等経費算定要領別表第3に定める人頭経費を徴収させていただきます。

(<https://unit.aist.go.jp/colpla/iuao2020/files/jutaku-keihi.pdf>)

詳細は、NPF事務局にお問い合わせ下さい。